

附件2

集成电路生产企业进口自用生产性原材料、消耗品免税商品清单

序号	性质	类别	HS 编码	品名	英文品名	适用企业	免税期限备注
1	一、直接原材料	导电树脂	38249099	导电胶	Electric Conductive Adhesive	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
2		保护膜	39199090	(硅片/光掩模、光罩)保护膜	(UV/ICROS Tape/Pellicle Glass) Tape	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
3			39199090	贴膜/（UV感应及非感应背磨/晶背研磨）胶带/胶膜	UV&NON-UV Curable Backgrinding Tape	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
4		剥离膜	39199090	剥离膜/揭膜（塑料制成卷，宽度>20cm）	Adhesive Tape (Plastic, Width>20cm)	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
5			39191099	剥离膜/揭膜（塑料制成卷，宽度≤20cm）	Adhesive Tape (Plastic, Width≤20cm)	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
6			40169990	剥离膜/揭膜（橡胶制）	Adhesive Tape (Rubber)	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
7		基板	85340090	基板（未装器件的印刷电路板）	Substrate	线宽小于0.25微米	至2018年底
8		支撑带	85429000	支撑带	Tab Tape	线宽小于0.25微米	
9		硅材料	38180019	8英寸、12英寸硅片	8inch、12inch Wafer	线宽小于0.25微米	
10			28046117 /28046119 /28046120	多晶硅（硅棒）	Polysilicon	线宽小于0.25微米	至2018年底
11		晶片	90019090	玻璃晶片	Glass Wafer	线宽小于0.25微米	
12			38180090	碳化硅片/ 调整片/ 晶圆	SiC Wafer	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	至2018年底
13			38180090	氮化镓外延片	GaN Wafer	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	至2018年底
14			38180090	碳化硅外延片	SiC Wafer	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	至2018年底
15	一、直接原材料	高纯度特殊气体	28011000	氯气(纯度≥5N)	Chlorine (Purity≥5N)	线宽小于0.25微米	至2018年底
16			28042100	氩气	Argon	线宽小于0.25微米	至2018年底
17			28042900	氙气	Xenon	线宽小于0.25微米	至2018年底
18			28042900	氦气	Helium	线宽小于0.25微米	至2018年底
19			28042900	氪气	Krypton	线宽小于0.25微米	至2018年底
20			28480000	磷烷	Phospine	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
21			28111990	溴化氢	Hydrogen Bromide	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
22			28112100	二氧化碳	Carbon Dioxide	线宽小于0.25微米	至2018年底
23			28112900	一氧化碳	Carbon Monoxide	线宽小于0.25微米	至2018年底
24			28112900	一氧化二氮（笑气）	Nitrous Oxide	线宽小于0.25微米	至2018年底
25			28530090	二氯(甲)硅烷	Dichlorosilane	线宽小于0.25微米	
26			28121049	三氯化硼	Boron Trichloride	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	

27			28129019	三氟化硼	Boron Trifluoride	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
28			28129019	六氟化硫	Sulfur Hexafluoride	线宽小于0.25微米	至2017年底
29			28261990	六氟化钨	Tungsten Hexafluoride	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
30			28500090	(甲)硅烷	Monosilane	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
31			29033990	三氟甲烷	Trifluoromethane	线宽小于0.25微米	至2018年底
32			29033990	四氟化碳	Tetrafluoromethane	线宽小于0.25微米	至2018年底
33	一、直接原材料	高纯度特殊气体	29038900	八氟环丁烷(八氟化四碳)	OCTA-FLUOROCYCLOBUTANE (C ₄ F ₈)	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
34			29038900	八氟环戊烯(八氟化五碳, 八氟环戊烷)	OCTA-FLUOROCYCLOPENTEN (C ₅ F ₈)	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
35			38249099	氩氖混合气体	Krypton/Neon	线宽小于0.25微米	
36			38249099	氩氟氖混合气	Krypton/F ₂ /Neon	线宽小于0.25微米	
37			38249099	氟氩混合气	F ₂ /Ne	线宽小于0.25微米	
38			28499090	六碳化铬	CrC ₆	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
39			28121049	六氯化硅(纯度≥6N)	Si ₂ Cl ₆ (Purity≥6N)	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
40			28500090	六氢化硅(纯度≥4N8)	Si ₂ H ₆ (Purity≥4N8)	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
41			29319090	三甲基硅烷	SiH(CH ₃) ₃	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
42			28061000	氯化氢	Hydrogen Chloride/Halocarbon	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
43			38249099	砷烷	AsH ₃ /H ₂	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
44			38249099	乙硼烷/氦气	B ₂ H ₆ /He	线宽小于0.25微米	
45			28129019	高纯度氟化硼	BF ₃	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
46			29033990	氟甲烷	CH ₃ F	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
47			28111100	氟化氢	HF	线宽小于0.25微米	至2018年底
48			28112900	一氧化氮(纯度≥6N)	NO (Purity≥6N)	线宽小于0.25微米	
49			28530090	二氯二氢硅	SiH ₂ Cl ₂	线宽小于0.25微米	
50			28500090	三氯氢硅	SiHCl ₃	线宽小于0.25微米	至2018年底
51			28121049	四氯化硅	SiCl ₄	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
52			38249099	锗烷氢气混合气体	GeH ₄ /H ₂	线宽小于0.25微米	至2018年底

53	一、直接原材料	高纯度特殊气体	28129019	四氟化硅	Silion Tetrafluoride(SiF ₄)	线宽小于0.25微米/线宽小于(含)0.5微米	
54			38249099	一氧化碳/氩气/氦气/二氧化碳/氙气混合气	CO/He/Ne/CO ₂ /Xe	线宽小于0.25微米	
55			38249099	三氯化硼/氢气混合气	BCl ₃ /H ₂	线宽小于0.25微米	
56			38249099	乙烯(纯度≥5N)/氢气混合气(纯度≥5N5)	C ₂ H ₄ (Purity≥5N)/He (Purity≥5N5)	线宽小于0.25微米	
57			38249099	甲基硅烷(纯度≥5N5)/氙气混合气(纯度≥6N)	CH ₃ SiH ₃ (Purity≥5N5)/Ar (Purity≥6N)	线宽小于0.25微米	
58			29012920	乙炔(纯度≥5N)	C ₂ H ₂ (Purity≥5N)	线宽小于0.25微米	
59			29012100	乙烯(纯度≥5N5)	C ₂ H ₄ (Purity≥5N5)	线宽小于0.25微米	
60			29012200	丙烯(纯度≥6N)	C ₃ H ₆ (Purity≥6N)	线宽小于0.25微米	
61			38249099	全氟丁二烯	C ₄ F ₆	线宽小于0.25微米	
62			29033990	二氟甲烷(纯度≥4N8)	CH ₂ F ₂ (Purity≥4N8)	线宽小于0.25微米	至2018年底
63			28459000	氖气(纯度≥5N)	D ₂ (Purity≥5N)	线宽小于0.25微米	
64			28042900	氦气	NE	线宽小于0.25微米	
65			28112900	二氧化硫(纯度≥4N)	SO ₂ (Purity≥4N)	线宽小于0.25微米	
66			29319090	三硅氮烷	TSA	线宽小于0.25微米	
67			38249099	氩气/氢气/氦气/一氧化碳/甲烷/二氧化碳/乙烷混合气	Ar/H ₂ /N ₂ /CO/CH ₄ /CO ₂ /C ₂ H ₆	线宽小于0.25微米	
68	一、直接原材料	高纯度特殊气体	29033990	六氟环丁烷	Hexafluoro-1,3-butadien	线宽小于0.25微米	
69			38249099	0.95%氟气, 3.5%氩气氦气混合气	0.95%F ₂ /3.5%Ar/Ne	线宽小于0.25微米	
70			28273990	四氯化钛	TiCl ₄	线宽小于0.25微米	
71			28129019	三氟化氯	ClF ₃	线宽小于0.25微米/线宽小于(含)0.5微米	
72			28261990	二氟化氙	XeF ₂	线宽小于0.25微米	
73			38249099	氯化氢氦气混合气	HCL/Ne	线宽小于0.25微米	
74			28273990	四氯化锆	HfCl ₄	线宽小于0.25微米	
75			38249099	二叔丁基硅烷二胺	BTBAS	线宽小于0.25微米	
76			38249099	氖气氮气混合气	D ₂ /N ₂	线宽小于0.25微米	
77			38249099	25PPM磷化氢氩气混合气	25PPM PH ₃ /Ar	线宽小于0.25微米	
78			29033990	八氟丙烷	C ₃ F ₈	线宽小于0.25微米	至2018年底
79			29319090	四-二甲胺钛	TDMAT	线宽小于0.25微米	
80			38249099	10PPM氙气/3.5%氩气/氦气混合气	10PPM Xe/Ar3.5%/Ne	线宽小于0.25微米	
81			29033990	六氟-1, 3-丁二烯	HEXAFLUORO-1,3-BUTADIENE	线宽小于0.25微米	
82			29033990	四氟乙烷	CH ₂ FCF ₃	线宽小于0.25微米	
83			29032990	反式1, 2-二氯乙烯DCE	TRANS-LC	线宽小于0.25微米/线宽小于(含)0.5微米	

84			28459000	三氟化氮	ND ₃	线宽小于0.25微米	
85			38249099	乙烯/氦气混合气	C ₂ H ₄ /He	线宽小于0.25微米	
86	一. 直接原材料	光刻工艺用化学品	37079090	显像液, 显影液 (光刻显像剂)	Developer	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
87			37071000	光刻胶	Photoresist	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
88			38140000	去胶剂	Photo Stripper	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
89			38249099	防反射薄膜生成液	BARC DUV	线宽小于0.25微米	
90			38140000	稀释液 (光刻显像稀释剂)	PM Thinner (THINNER series)	线宽小于0.25微米	
91			38140000	(净化) 稀释液	Cleaning Solution Thinner	线宽小于0.25微米	
92			38249099	聚酰亚胺原液 (感光性聚酰亚胺)	HP/Photo sensitive polyimide	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
93			29319090	双 (三甲基硅) 胺	Hexamethyldisilazane OAP	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
94			29141900	甲基戊基酮	Methyl Amyl Keton	线宽小于0.25微米	
95			34059000	氧化铝研磨浆	Alumina Slurry	线宽小于0.25微米	
96			37013090	光刻工艺专用高等级感光胶片	Photosensitive Film	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
97			38249099	增粘剂	TARC	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
98			38249099	粘附剂	PRIMER	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
99			38249099	无尘制冷剂	COOLANT	线宽小于0.25微米	
100			29094990	丙二醇甲醚	Adhesion Promoter	线宽小于0.25微米	
101		光刻工艺用化学品	29319090	四甲基硅烷	(CH ₃) ₄ Si, Tetramethylsilane, C ₄ H ₁₂ Si	线宽小于0.25微米	
102	一. 直接原材料	光刻工艺用化学品	34029000	消泡剂	Defoamers	线宽小于0.25微米	
103		抛光剂	34059000	研磨剂 (二氧化硅/STI/钨/多晶硅/铝/铜/阻挡层研磨剂)	CMP Slurry (SiO ₂ /STI/W/Al/Cu/Barrier layer)	线宽小于0.25微米	
104			34029000	用于化学机械研磨 (CMP) 表面活性剂	CMP SURFACTANT	线宽小于0.25微米	
105			34059000	二氧化铈研磨剂	CeO ₂ Slurry	线宽小于0.25微米	
106		掺杂源	28047090	(高纯度) 红磷	High Purity Red Phosphorus	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
107			28048000	(高纯度金属) 砷	Arsenic Metal	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
108			28129090	硼源	Boron Source	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	
109			28129090	磷源	Phosphorsilicate Polymers and Organic Solvents	线宽小于0.25微米/线宽小于 (含) 0.5微米	

110			28129090	三溴化磷	PBR ₃	线宽小于0.25微米	
111			28273990	三氯化铟	Indium Trichloride	线宽小于0.25微米	
112			28261990	四氟化锗	GeF ₄	线宽小于0.25微米	
113			28261990	三氟化铟	InF ₃	线宽小于0.25微米	
114		刻蚀液	28111100	氢氟酸	HydrogenFluoride	线宽小于0.25微米	至2018年底
115			38249099	氢氟酸硝酸混合液	FilmEtchPoly	线宽小于0.25微米	至2018年底
116			38249099	剥离液	Resist Strip	线宽小于0.25微米	
117			38249099	氧化物刻蚀缓冲剂	Buffered Oxide Etch	线宽小于0.25微米	
118			29053100	乙二醇	Ethylene Glycol	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
119	一、直接原材料	刻蚀液	38249099	乙二醇氟化胺混合液	EG+NH ₄ F	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
120			29319090	六甲基乙硅烷	HMDS/HD POLYIMIDE	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
121			38249099	铝刻蚀液	DAE Defreckling Alumimun Etch	线宽小于0.25微米	至2018年底
122			37071000	感光乳液	Photosensitive Emulsion	线宽小于0.25微米	
123			38249099	酸碱度调整添加剂	Acid&Alkali PH adjuster additives	线宽小于0.25微米	
124			38249099	硅片背面刻蚀液	Etchant for BSM	线宽小于0.25微米	
125			38249099	铜刻蚀液	Cu Etchant	线宽小于0.25微米	
126			38249099	钛刻蚀液	Ti Etchant	线宽小于0.25微米	
127			38249099	金刻蚀液	Au Etchant	线宽小于0.25微米	
128			38249099	钛钨刻蚀液	Ti-W Etchant	线宽小于0.25微米	
129			38249099	镍刻蚀液	Ni Etchant	线宽小于0.25微米	
130			38249099	旋转刻蚀液	Etchant	线宽小于0.25微米	
131			34021900	苯丙三氮唑	BTA	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
132			28273500	氯化镍	Nickle Chloride	线宽小于0.25微米	
133			28309090	硫化镍	Nickelsulfate	线宽小于0.25微米	
134			28061000	盐酸（杂质含量≤0.1PPB）	Hydrochloric Acid(Hcl) （Impurity≤0.1PPB）	线宽小于0.25微米	至2018年底
135			28261990	氟酸铵	Ammonium Fluoride	线宽小于0.25微米	
136			29041000	甲基磺酸	Methanesulfonic Acid	线宽小于0.25微米/线宽 小于（含）0.5微米	
137			28070000	硫酸（杂质含量≤0.1PPB）	Sulfuric Acid（Impurity≤ 0.1PPB）	线宽小于0.25微米	至2018年底
138			28080000	硝酸（杂质含量≤0.1PPB）	Nitric Acid（Impurity≤ 0.1PPB）	线宽小于0.25微米	至2018年底
139			28092019	磷酸（杂质含量≤10PPB）	Phosphoric Acid（Impurity≤ 0.1PPB）	线宽小于0.25微米	至2018年底
140			28142000	氨水（杂质含量≤1PPB）	NH ₃ .H ₂ O（Impurity≤ 0.1PPB）	线宽小于0.25微米	至2017年底

141	一、直接原材料	清洗液	29051220	异丙醇（杂质含量≤0.1PPB）	IsopropylAlcohol（Impurity≤0.1PPB）	线宽小于0.25微米	至2018年底
142			28152000	氢氧化钾（杂质含量≤0.1PPM）	Potassium Hydroxide Solution（Impurity≤0.1PPM）	线宽小于0.25微米	至2018年底
143			28261990	氟化钾（杂质含量≤0.1PPM）	Potassium Fluoride KF（Impurity≤0.1PPM）	线宽小于0.25微米	至2018年底
144			38249099	混合酸（1.硝酸+醋酸+氢氟酸；2.硝酸+醋酸+磷酸；3.氢氟酸+氟化铵）（杂质含量≤1PPB）	Mixed Acid (1.HNO ₃ +CH ₃ COOH+HF; 2.HNO ₃ +CH ₃ COOH+H ₃ PO ₄ ; 3.HF+NH ₄ F)（Impurity≤1PPB）	线宽小于0.25微米	至2018年底
145			38220090	钼酸盐试剂（杂质含量≤1PPM）	Molybdate 3 Reagent（Impurity≤1PPM）	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
146			29051990	异丙基乙醇（杂质含量≤1PPB）	Isopropyl Alcohol（Impurity≤1PPB）	线宽小于0.25微米	
147			29189900	1-甲氧基丙基乙酸酯清洗液（杂质含量≤1PPB）	Rinse For Polyimide（Impurity≤1PPB）	线宽小于0.25微米	
148			38249099	光刻胶去除剂	Stripper For Photoresist	线宽小于0.25微米	
149			29189900	甲氧基乙酸丙脂（杂质含量≤1PPB）	RER（Impurity≤1PPB）	线宽小于0.25微米	
150			38220090	柠檬酸	Citric Acid Reagent	线宽小于0.25微米	
151	一、直接原材料	电镀液	38249099	镍电镀原液	Ni Plating Solution	线宽小于0.25微米	至2018年底
152			38249099	金电镀液	Au Plating Solution	线宽小于0.25微米	至2018年底
153			38101000	锡银电镀原液	Sn-Ag Plating Solution	线宽小于0.25微米	至2018年底
154			38249099	平坦剂	Viaform Extreme Leveler	线宽小于0.25微米	
155			38249099	加速剂	Viaform Accelerator	线宽小于0.25微米	
156			29420000	铜抑制剂	Cubath Viaform	线宽小于0.25微米	
157			38249099	抑制剂	Inhibitor	线宽小于0.25微米	
158			29072210	对苯二酚	Hydroquinone	线宽小于0.25微米	
159		化学品、化学试剂	29199000	磷酸三乙酯	TEPO	线宽小于0.25微米	
160			29209090	硼酸三乙酯	TEB	线宽小于0.25微米	
161			29319090	八甲基硅醚	Octamethylcyclotetrasiloxane	线宽小于0.25微米	
162			29032990	偏氯乙烯	TRANS1-2-DICHLOROETHYLENE	线宽小于0.25微米	
163			29319090	四乙氧基硅烷	TEOS	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
164			38249099	光罩蚀刻机清洗剂	AP/Mineral Acid	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
165			38249099	铬蚀刻液	CR/Chromium Etching	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
166			34029000	表面活性剂制品	Additive/Buffered Etch	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	

167			29319090	三乙基硼烷	TEB	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
168	一、直接原材料	化学品、化学试剂	39049000	六氟代聚丙烯	Six Fluorinated Polypropylene	线宽小于0.25微米	
169			29209011	亚磷酸三甲酯	TMP	线宽小于0.25微米	
170			28274910	四氯化锆	ZrCl ₄	线宽小于0.25微米	
171			29319090	四甲基环四硅氧烷	ZTMCATS	线宽小于0.25微米	
172			34029000	清洗溶液（纯度≥7N5）	Clean Chemical（Purity≥7N5）	线宽小于0.25微米	
173			29420000	二羰基环戊二烯钴	COCP(CO ₂)	线宽小于0.25微米	
174			29319090	二三阶四碳氨基硅甲烷	BTBAS	线宽小于0.25微米	
175			38249099	二乙氧基甲基硅烷	DEMS	线宽小于0.25微米	
176			29299090	四二甲胺基铅	TDMAH	线宽小于0.25微米	
177			29319090	八甲基环四硅氧烷	Octamethyl cyclotetrasiloxane	线宽小于0.25微米	
178			29337900	N-甲基吡咯烷酮	NMP	线宽小于0.25微米	
179			29032990	二氯乙烷	C ₂ H ₂ CL ₂	线宽小于0.25微米	
180			38140000	氢化硅氮烷聚合物稀释剂	Hydrogenated Silicon Polymer Diluent	线宽小于0.25微米	
181			29212900	氨基硅烷	2NTe	线宽小于0.25微米	
182			29319090	三硅基氮	TSA	线宽小于0.25微米	
183			29319090	六羰基铬	Cr(CO) ₆	线宽小于0.25微米	
184			29319090	第三丁基乙炔六羰基二钴	CCBTA	线宽小于0.25微米	
185			29319090	二甲基氯化铝	DMAH	线宽小于0.25微米	
186			29319090	二甲基胺乙基氯化铝	DMEAA	线宽小于0.25微米	
187			29319090	二甲基乙基胺	DMEA	线宽小于0.25微米	
188	一、直接原材料	化学品、化学试剂	29319090	五二甲基氮钼	PDMAT	线宽小于0.25微米	
189			29211100	三甲基甲硼烷	TMAAB	线宽小于0.25微米	
190			29319090	双（二乙基氨基）硅烷	Bis(diethylamido) Silane	线宽小于0.25微米	
191		掩模版	90029090	掩模版	Exposed & Developed Photo Mask	线宽小于0.25微米/线宽小于（含）0.5微米	
192			37019920	光刻模板	Mask,Mask Substrate Material	线宽小于0.25微米	
193			74199991	铜靶材(>99%)	Target Cu (>99%)	线宽小于0.25微米	至2018年底
194			76169910	铝靶材(>99%)	Target Al (>99%)	线宽小于0.25微米	至2018年底
195			81019990	钨金属靶(>99%)	Target W (>99%)	线宽小于0.25微米	至2018年底
196			76169910	铝-铜靶(Al>99%,Cu≤1%)	Target Al-Cu (Al>99%,Cu≤1%)	线宽小于0.25微米	至2018年底
197			76169910	铝-硅靶(Al>99%,Si≤1%)	Target Al-Si (Al>99%,Si≤1%)	线宽小于0.25微米	至2018年底
198			76169910	铝-硅-铜靶(Al>98%,Si<1%,Cu<1%)	Target Al-Si-Cu (Al>98%,Si<1%,Cu<1%)	线宽小于0.25微米	至2018年底

199		靶材	81059000	钴靶(>99%)	Target Co (>99%)	线宽小于0.25微米	至2018年底
200			75089080	镍靶(>99%)	Target Ni (>99%)	线宽小于0.25微米	至2018年底
201			81039090	钽靶(>99%)	Target Ta (>99%)	线宽小于0.25微米/线宽小于(含)0.5微米	
202			81089090	钛靶(>99%)	Target Ti (>99%)	线宽小于0.25微米/线宽小于(含)0.5微米	
203			71159010	铂靶(>99%)	Target Pt (>99%)	线宽小于0.25微米	
204			71081300	金靶	Target Au	线宽小于0.25微米	
205			71159010	银靶	Target Ag	线宽小于0.25微米	至2018年底
206			84869091	硅靶	Target Si	线宽小于0.25微米	
207			84869091	钛铝靶	Target TiAl	线宽小于0.25微米	
208	一、直接原材料	靶材	75062000	镍钇靶材	Target Ni-V	线宽小于0.25微米	
209			71159010	镍铂金靶	Target Ni-Pt	线宽小于0.25微米	
210			81129910	锗靶	Target Ge	线宽小于0.25微米	
211			71069210	银粒/银块	Silver Grain/Bullion	线宽小于0.25微米	
212		银浆	38249099	银浆	Ag PASTE	线宽小于0.25微米	
213	二、间接生产材料	研磨用品	68042290	研磨垫子	Polishing Pad/Backing Pad	线宽小于0.25微米	
214			68042100	化学机械研磨钻石盘	Diamond Disks for CMP	线宽小于0.25微米	
215			39269010	化学机械研磨胶垫中间软垫(塑料)	Insert Film (Plastic)	线宽小于0.25微米	
216			40169310	化学机械研磨胶垫中间软垫(橡胶)	Insert Film (Rubber)	线宽小于0.25微米	
217			39269010	化学机械研磨头内垫(橡胶制)	Membrane	线宽小于0.25微米	
218			96035091	化学机械研磨胶垫处理刷子	PVA Brush	线宽小于0.25微米	
219			68053000	钻石研磨抛光布	Grit Diamond Pad	线宽小于0.25微米	
220		硅片盒	39231000	硅片盒/晶舟盒	FOUP	线宽小于0.25微米	
221		硅片处理用品	48239090	硅片衬纸	Separator Sheet	线宽小于0.25微米	
222			39269090	硅片盒用塑料把手	Pod Handle	线宽小于0.25微米	
223			39269090	硅片盒用塑料支架	Cassette Hold Down	线宽小于0.25微米	
224		真空泵油	34031900	真空泵油	Vacuum Pump Oil	线宽小于0.25微米	
225		交换树脂	39140000	离子交换树脂(更换后水质电阻值≥18MΩ·cm)	Ion Exchange Resin (water resistance≥18MΩ·cm)	线宽小于0.25微米	
226		过滤材料	39209990	反渗透膜	RO Membrane For Clean Room	线宽小于0.25微米/线宽小于(含)0.5微米	
227	二、间接生产材料	过滤芯	84219990	(液体)过滤芯	(Liquid) Filter	线宽小于0.25微米	
228			84219990	(气体)过滤芯	(Gas) Filter	线宽小于0.25微米	
229			84219990	其他过滤芯	Filter	线宽小于0.25微米	
230		石英制品	70200019	生产用石英制品	Quartz Parts	线宽小于0.25微米	
231		光罩用品	39269090	光罩盒	Reticle/Mask POD	线宽小于0.25微米	
232			39231000	塑料制光罩传递盒	LCP Reticle SMIF POD	线宽小于0.25微米	
233			39239000	防静电光罩保护袋	Anti-Static Metal Bag	线宽小于0.25微米	
234			90309000	探针卡/探针	Prober Card	线宽小于0.25微米	
235		探针用品	85444990	探针连接线(电线)	Prober Card Cable	线宽小于0.25微米	
236			68052000	(探针卡/针尖)清洗片	(Prober)Clean Sheet	线宽小于0.25微米	
237		电子标签	85437099	电子标签	Smart Tag	线宽小于0.25微米	

238	专用灯管	85393290	专用灯(氙灯、汞灯、卤素灯、卤钨灯)	Dedicated Lamp	线宽小于0.25微米	
239		85393990	专用黄灯管	Fluorescent Lamp	线宽小于0.25微米	
240		85394900	专用紫外线灯	UV Lamp	线宽小于0.25微米	
241	设备专用消耗品	82089000	键合劈刀	Wirebond Capillary	线宽小于0.25微米	
242		81019600	离子注入机专用灯丝	Filament	线宽小于0.25微米	

注：适用企业一栏中，“线宽小于0.25微米”代指投资额超过80亿元人民币或集成路线宽小于0.25微米的集成电路生产企业，“线宽小于（含）0.5微米”